# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 06-202098 (43)Date of publication of application: 22.07.1994

(51)Int.Cl. **G02F** 1/1335 **G02F** 1/1343

(21)Application number: **05-015966** (71)Applicant: **CITIZEN WATCH CO LTD** 

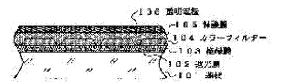
(22)Date of filing: 05.01.1993 (72)Inventor: YAMADA OSAMU

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

# (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent electrical shorting between a light shielding film and transparent electrode and to stably supply the liquid crystal display having high display quality by newly providing an insulating film separately from a protective film between the light shielding film having an electrical conductivity and the transparent electrode.

CONSTITUTION: This liquid crystal display panel has the light shielding film 102 which is provided on a first substrate 101 and has an electrical conductivity, an insulating film 103 which is provided on the light shielding film 102, color filters 104 which are provided on this insulating film 103, the protective film 105 which is provided on these color filters 104 and the transparent electrode 106 provided on the protective film 105. Since the insulating film 103 and the protective film 105 are provided as multilayered films between the light shielding film 102 and the transparent electrode 106 even if a metallic thin film having the electrical conductivity but an in sufficient light shielding characteristic is used as the light shielding film 102, and even if there is a pinhole in the insulating film 103, the generation of the electrical shorting between the light shielding film 102 and the transparent electrode 106 is surely prevented by the multilayered structure with the protective film 105.



## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-202098

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

(51)Int.Cl.5 識別記号 庁内整理番号 F I 技術表示箇所

G 0 2 F 1/1335 5 0 5 7408-2K 1/1343 8707-2K

審査請求 未請求 請求項の数9 (全 7 頁)

シチズン時計株式会社

(21)出願番号 特願平5-15966 (71)出願人 000001960

(22)出願日 平成5年(1993)1月5日 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 山田 修

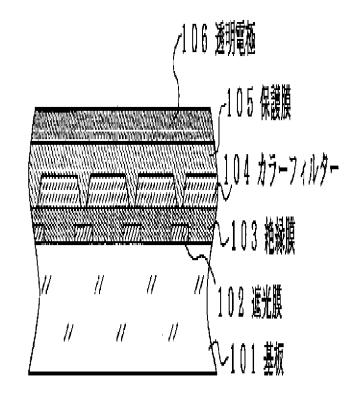
埼玉県所沢市大字下富字武野**840番地** シ チズン時計株式会社技術研究所内

(54) 【発明の名称 】 液晶表示パネル

# (57) 【要約】

【構成】 基板101の上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜上に設けるカラーフィルター104と、カラーフィルター上に設ける保護膜105と、保護膜上に設ける透明電極106とを有する。

【効果】 いずれかの層にピンホールがあってもこの多層膜構造で遮光膜と透明電極の電気的ショートを確実に防止できる。このため遮光特性の不充分な絶縁体を用いた遮光膜を使用する必要がなく、遮光特性の優れた、平坦性の優れた表示品質の高い液晶表示パネルを歩留まりを低下させること無く生産でき、しかも既存の保護膜、あるいはカラーフィルターを利用して多層膜構造を形成しているため、最小限の工程の追加ですむから大幅な価格上昇もない。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設けるカラーフィルターと、カラーフィルター上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設けるカラーフィルターと、カラーフィルター上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける透明電極とを有すことを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項3】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設けるカラーフィルターと、カラーフィルター上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項4】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設けるカラーフィルターとに設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項5】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設けるカラーフィルターと、カラーフィルター上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項6】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項7】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける絶縁膜と、絶縁膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項8】 基板上に設ける導電性を有する遮光膜と、遮光膜上に設けるカラーフィルターと、カラーフィルター上に設ける保護膜と、保護膜上に設ける透明電極とを有することを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項9】 絶縁膜は、酸化シリコン、窒化シリコン、炭化シリコン、酸化チタン、酸化ジリコニウムから選ばれる一つあるいは複数で構成することを特徴とする請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項5、請求項6、あるいは請求項7記載の液晶表示パネル。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示パネルの基板 の構造に関し、さらに具体的には導電性を有する遮光膜 を設けた基板の構造に関するものである。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルは基本的には複数の透明 電極を形成した2枚の基板を、透明電極を形成した面を 対向させ、シール材により封止し、これに液晶材料を注 入して構成する。

【0003】以下図面に基づいて従来技術を説明する。 図9は従来のカラー液晶表示パネルの構造を示す断面図 である。

【0004】図9に示すように、第1の基板101上にはカラーフィルター104が設けられ、カラーフィルター104上には保護膜105が設けられ、保護膜105上には透明電極106が設けられている。液晶300を介して第1の基板101と対向する第2の基板201には、透明電極206が設けられている。ここで透明電極106と透明電極206上には、実際には配向膜が設けられているが、図示を省略してある。

【0005】この図9に示す構成の場合、保護膜105はカラーフィルター104の層表面の凹凸を吸収し、透明電極106の表面を平坦化するために用いられる。すなわち対向する透明電極106と透明電極206の間隔に不均一な部分があると、この部分およびその近傍において、表示の明るさの不均一、液晶の配向の不均一などを生じ、表示品質を低下させる原因になる。このため基板の透明電極面を平坦に仕上げるため、保護膜105を設けるのである。

【0006】しかし比較的低分割駆動の液晶表示パネルの場合、保護膜無しでも許容可能な平坦性を得られるため、この保護膜の形成を廃止することもある。

【0007】透明電極106と透明電極206とは、互いにマトリクス状に配置され、その対向する部分が表示に関与する画素部分であり、その他の部分は表示に関与しない非画素部分である。非画素部分は表示全体のコントラストを低下させないためには、光透過率が零であることが望ましい。

【 O O O 8 】しかし実際には種々の理由により光が漏れるため、表示品質を著しく下げてしまう。そこで非画素部分からの光漏れを防止する工夫が試みられている。

【0009】図10は非画素部分の光漏れを防止した従来例における第1の基板101を示す断面図であり、隣合うカラーフィルター104をオーバーラップさせて、遮光効果を得ようとするものである。

【0010】この図10に示す構成にはいくつかの欠点がある。1つは遮光効果を高めるためには、隣合うカラーフィルター104が完全にオーバーラップしている必要があり、このオーバーラップ部分が凸状になってしまう。

【 O O 1 1 】この凸状部分は距離が比較的大きいため、 保護膜 1 O 5 によっても表面段差が吸収されず、透明電 極 1 O 6 の平坦性が損なわれることになる。

【 O O 1 2 】またさらに、カラーフィルター 1 O 4 が完全にオーバーラップした部分においても、多少の光漏れが生じ、完全な遮光方法とはいえない。

【OO13】またこの方法では、カラーフィルター10 4に平行な非画素部分に対してしか遮光効果が得られ ず、カラーフィルター104に直交する非画素部分は遮 光することができない。

【 O O 1 4 】図 1 1 は他の従来例における第 1 の基板 1 O 1 を示す断面図である。

【0015】図11に示すように、第1の基板101の上に遮光膜102を設け、この遮光膜102の上にカラーフィルター104を設け、カラーフィルター104の上に保護膜105を設け、保護膜105の上に透明電極106を設ける。

【0016】この図11に示す構成によれば、カラーフィルター104とは独立して遮光膜102を設けることができる。その結果、遮光膜102形状を井桁状に構成することにより、カラーフィルター104に平行な非画素部分に対しても、遮光効果が得られ、さらにカラーフィルター104に直交する非画素部分に対しても遮光効果を得ることができる。

【0017】遮光膜102の形成法として、絶縁材料である黒色顔料や黒色染料を分散した黒色樹脂を印刷法やフォトエッチング法で形成する方法もあるが、この黒色樹脂材料の吸光度は低く、膜厚が薄い場合は充分な遮光特性が得られない。

【0018】この黒色樹脂で充分な遮光特性を得るには、樹脂膜厚を充分に厚くすることが必要になる。しかしながら、このように膜厚を厚くした場合には、遮光膜の部分と有効画素となる遮光膜の無い部分とで大きな表面段差が生じ、この段差を保護膜105で平坦化することは困難である。

【 0 0 1 9 】このように平坦性の不足した基板構造を持つ液晶表示パネルは、液晶の配向不均一をおこし、表示品質の悪いものとなることは前述の通りである。この問題を解決するため、遮光膜 1 0 2 の材料として金属薄膜が用いられる。

【0020】遮光膜102に金属材料を用いた場合の、図11に示した従来例の製造工程を簡単に説明すると、第1の基板101上にスパッタリング法あるいは真空蒸着法などによって、クロムなどの不透明な金属薄膜を形成した後、フォトエッチング法で所定のパターンを形成し遮光膜102とする。

【0021】その遮光膜102上に、印刷法、染色法、顔料分散法などを用いてカラーフィルター104上にポリイミる。さらに、そのカラーフィルター104上にポリイミド、アクリルなどの透明樹脂を印刷法、スピンコート法を用いて保護膜105を設ける。その保護膜105上全面にスパッタリング法、真空蒸着法などを用いて、透明電極106となる酸化インジュウム錫膜を形成させる。この酸化インジュウム錫膜をフォトエッチング法で所定のパターン形状に加工して、透明電極106とする。

【0022】遮光膜102を金属薄膜とした場合、保護膜105は前述のように平坦化作用に加え、遮光膜10 2と透明電極106との間の絶縁膜としての作用をも有 することになる。

## [0023]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、遮 光膜102に金属薄膜を使用することが充分な遮光特性 を持ち、透明電極106の表面平坦性を確保できる遮光 膜102を形成する現実的な方法である。また遮光膜1 02である金属薄膜は、フォトエッチング法で微細なパ ターン形状加工ができることも長所である。

【0024】しかし金属薄膜を遮光膜102として使用した場合、しばしば遮光膜102と透明電極106との間で電気的ショートが起こり、歩留まりを大幅に低下させてしまうという問題点が発生する。

【0025】これは、保護膜105で、遮光膜102と透明電極間106との間は電気的に絶縁されている筈であるが、実際には保護膜105には微細なピンホールが多数あり、このピンホールを介して遮光膜102と透明電極106との間が電気的にショートしてしまうのである。この保護膜105に発生するピンホールを完全に無くすことは、現在のところ非常に難しい。

【0026】本発明は、従来のこのような問題を解決し、その目的とするところは遮光膜と透明電極との電気的なショートを防ぎ、表示品質の高い液晶表示パネルを安定して供給することにある。

#### [0027]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明が用いる第1の手段は、導電性を有する遮光膜と透明電極の間に保護膜とは別に新たに絶縁膜を設けることであり、第2の手段は隣合うカラーフィルターを僅かにオーバーラップさせて絶縁層として活用することである。

## [0028]

### [0029]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面によって説明するが、図面は構造のみを示すものであって寸法などについて示すものではない。また透明電極上の配向膜などは図示していない。

【 〇 〇 3 〇 】図 1 は本発明の第 1 の実施例における第 1 の基板 1 〇 1 を示す断面図である。

【0031】図1に示すように、第1の基板101上の 全面にまずスパッタリング法あるいは真空蒸着法を用い てクロム薄膜を形成し、そのクロム薄膜をフォトエッチング法にて所定のパターンに形成し、遮光膜 1 0 2 を設ける。

【0032】さらに遮光膜102上にスパッタリング法で、硬質で透明な絶縁体である酸化シリコンを形成し、 絶縁膜103を形成する。さらにその後、絶縁膜103 上に染色法を用いて直接カラーフィルター104を形成する。

【0033】その後さらに、カラーフィルター104上にスピンコート法を用い透明なアクリル樹脂を全面に塗布し、保護膜105を設ける。さらに、保護膜105上にスパッタリング法で酸化インジュウム錫薄膜を全面に形成した後、フォトエッチング法で所定のパターンを形成し、透明電極106を設ける。

【0034】すなわち図1に示す第1の実施例は、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設けるカラーフィルター104と、カラーフィルター104上に設ける保護膜105と、保護膜105上に設ける透明電極106とを有する構造となる。

【0035】この図1に示す構造を採用する本発明によれば、遮光膜102として導電性はあるが遮光特性の充分な金属薄膜を使用しても、絶縁膜103と保護膜105とが多層膜として、遮光膜102と透明電極106との間に設けられている。このため、たとえ絶縁膜103にピンホールがあっても、保護膜105との多層膜構造で、遮光膜102と透明電極106との電気的ショートの発生を確実に防ぐことができる。

【0036】図2は本発明の第2の実施例における第1の基板101を示す断面図で、絶縁膜103をカラーフィルター104上に設けた構造を示す。

【0037】図2に示すように、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設けるカラーフィルター104と、このカラーフィルター104上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設ける保護膜105と、保護膜105上に設ける透明電極106とを有する構造である。

【0038】この第2の実施例でも、図1に示した第1の実施例と同様に、遮光膜102と透明電極106の間に、絶縁膜103と保護膜105との多層膜が形成されるため、遮光膜102と透明電極106の間の電気的ショートの発生を防止することができる。

【0039】図3は本発明の第3の実施例を示す断面図で、絶縁膜103を保護膜105上に設けた構造を示す。

【0040】図3に示すように、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設けるカラーフィルター104と、このカラーフィルター104上に設ける保護膜105と、保護膜105上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設ける透明

電極106とを有する構造である。

【0041】この第3の実施例でも、図1に示した第1の実施例と同様に、遮光膜102と透明電極106の間に絶縁膜103と保護膜105との多層膜が形成されるている。このため、遮光膜102と透明電極106の間の電気的ショートの発生を防止することができる。

【0042】図4に本発明の第4の実施例における第1の基板101の断面図を示す。第4の実施例の構造は、図1から図3に示す保護膜105を廃止し、カラーフィルター104を絶縁層として活用した構造である。

【0043】図4に示すように、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設けるカラーフィルター104、とカラーフィルター104上に設ける透明電極106とを有する構造である。

【 0 0 4 4 】保護膜 1 0 5 を設ける目的は、一義的には透明電極 1 0 6 の表面平坦性の向上にある。しかし比較的低分割駆動の場合、駆動マージンが広いために、不充分な平坦性でも使用可能な表示品質を得ることができる。このような場合には保護膜 1 0 5 を廃止することが可能である。

【0045】しかし先に述べたように、金属薄膜による 遮光層102を設けた場合には、保護膜105は多層膜 絶縁層の一部としての機能も有するのであるから、単に 保護膜105を廃止しただけでは多層膜による絶縁構造 が失われ、絶縁膜103にピンホールが存在すれば、や はり透明電極106と遮光膜102の間の電気的ショー トが生ずる。

【0046】そこで図4に示すように、隣合うカラーフィルター104を互いにオーバーラップし、遮光膜102と透明電極106との間にカラーフィルター104と 絶縁膜103とによる多層膜による絶縁構造を構成する。

【0047】この場合、遮光効果は遮光膜102によって得ているのであるから、従来例の図10で示したような大きな凸部生じるような、カラーフィルター104のオーバーラップは必要ない。なおオーバーラップが小さい場合には、工程ばらつきにより部分的に隙間が生じてしまうこともあり得るが、その場合でも電気的ショート事故発生の確率は大幅に低下する。

【0048】図5は本発明の第5の実施例における第1の基板101を示す断面図であり、保護膜105を廃止して、かつ絶縁膜103をカラーフィルター106上に設けた構造を示す。

【0049】図5に示すように、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設けるカラーフィルター104と、このカラーフィルター104上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設ける透明電極106とを有する構造である。

【0050】カラーフィルター104を、図4を用いて

説明した第4の実施例と同じく、オーバーラップさせることにより、カラーフィルター104と絶縁膜103とからなる多層膜構造の絶縁層を得ることができる。

【0051】図4を用いて説明した第4の実施例と同じように、図5に示した第5の実施例では、保護膜105を設ける工程を廃止でき、低価格の液晶表示パネルを提供できる。また適切なオーバーラップを行えば、結果的に透明電極106の平坦性を向上させることもできる。

【0052】図6は本発明の第6の実施例における第1の基板101を示す断面図であり、カラーフィルターを使用しない、白黒表示の液晶表示パネルにおける第1の基板101の構造である。

【0053】図6に示した構造についてその製造工程を 簡単に述べると、第1の基板101上の全面にまずスパッタリング法あるいは真空蒸着法を用いてクロム薄膜を 形成させる。そのクロム薄膜をフォトエッチング法にて 所定のパターンに形成し、遮光膜102を設ける。

【0054】この遮光膜102上にスパッタリング法で、硬質な透明絶縁体である酸化シリコンを形成し絶縁膜103を形成し、絶縁膜103上にスピンコート法を用い透明なアクリル樹脂を全面に塗布し保護膜105を設ける。さらに、保護膜105上にスパッタリング法で酸化インジュウム錫薄膜を全面に形成した後に、フォトエッチング法で所定のパターンを形成し、透明電極106を設ける。

【0055】この説明のようにして、第6の実施例では基板上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設ける保護膜105と、保護膜上105に設ける透明電極106を有する構造となり、多層膜構造の絶縁層を得ることができる。

【0056】絶縁膜103と保護膜105とが、遮光膜102と透明電極106との間に設けられているため、 遮光膜102と透明電極106との電気的ショート発生 を防止することができる。

【0057】図7は本発明の第7の実施例における第1の基板101を示す断面図であり、カラーフィルターを有しない基板において、絶縁膜103を保護膜105上に設けた構造を示す。

【0058】図7に示すように、第1の基板101上に設ける導電性を有する遮光膜102と、遮光膜102上に設ける保護膜105と、この保護膜105上に設ける絶縁膜103と、絶縁膜103上に設ける透明電極106とを有する構造である。

【0059】図6を用いて説明した第6の実施例と同様に、第7の実施例においても多層膜構造の絶縁層を得ることができる。したがって、透明電極106と遮光膜102との電気的ショート発生を、保護膜105と絶縁膜103とによって抑えることができる。

【0060】図8は本発明の第8の実施例における第1

の基板101を示す断面図である。この第8の実施例に おいては絶縁膜103の機能をカラーフィルター104 のオーバーラップにより得ている。

【0061】カラーフィルター104のオーバーラップによる効果などについては図4、図5を用いて説明した第4、第5の実施例の説明で述べたとおりであり、説明を省略する。

【0062】本発明の趣旨は以上の実施例の説明で明かであるが、なお若干の細補足を行えば、図1に示した第1の実施例、あるいは図6に示した第6の実施例の説明中、遮光膜102としてクロム薄膜を用いて説明した。しかしながら、遮光膜102としては、これ以外にも充分な遮光特性を得られる、タンタル、ニッケル、アルミチタンなどの薄膜を用いてもよい。

【0063】また絶縁膜103としては、スパッタリング法を用いて酸化シリコンを形成したが、酸化シリコン以外に、窒化シリコン、炭化シリコン、酸化チタン、酸化ジリコニウムなどを、印刷法、真空蒸着法、ディップ法などを用いて形成することができる。

【0064】さらに保護膜105としては、透明なアクリル樹脂以外にも、透明なポリイミド樹脂、透明なエポキシ樹脂を使用することも可能である。また保護膜105の形成方法としてはスピンコート法以外にも、印刷法、ディッピング法も使用できる。

【0065】さらにカラーフィルター104については、染色法以外にも印刷法、顔料分散法を用いてカラーフィルター104を形成することも可能である。

【 O O 6 6 】また図 1 、図 4 、図 6 に示した実施例の場合、絶縁膜 1 O 3 は耐熱性のすぐれた第 1 の基板 1 O 1 および金属薄膜による遮光膜 1 O 2 上への設置であり、比較的高温で安定した絶縁膜 1 O 3 を設けることができる。またこのような安定した膜であるため、従来の製造工程をそのまま使用することが可能である。

【0067】つぎに図2と図3との比較において、絶縁膜103と保護膜105との関係について述べる。絶縁膜103と保護膜105とは、ともに絶縁層としての機能を果たすのであるが、絶縁膜103は専ら絶縁機能を、保護膜105は絶縁機能の他に前述の平坦化の目的をも有している膜と理解すれば良い。したがって両者の材質、膜厚などが異なる場合は、図2と図3は異なる実施例を示すことになる。

【0068】しかしながら、絶縁膜102を保護膜105と同一の材料で同一の膜厚で設けて、両者にともに絶縁機能と平坦化機能とを均等に負わせる場合には、図2と図3とは構造的には同一のものとなる。

【0069】同様なことが図6と図7においても言える。図6と図7においては段差を形成するカラーフィルター104が存在しないから、保護膜105に求められる平坦化の機能はそれほど必要がない。したがって絶縁膜102を保護膜105と同一の材料で同一の膜厚で設

けるならば、図6と図7とは構造的には同一のものとなる。

【OO70】しかしながらカラーフィルター104が無い場合には、他の機能がこれらの絶縁層に求められる。

【0071】すなわち遮光膜102が液晶表示パネルの有効表示面全面に井桁状に設けられて、そしてすべての遮光膜102が電気的に接続している場合、それぞれの透明電極106は、遮光膜102を介して容量的に結合する。この容量結合は、透明電極106が有する電気的抵抗と関係して液晶に印加する駆動電圧に歪みを生じさせ、液晶表示パネルの表示状態を悪化させる原因になる。

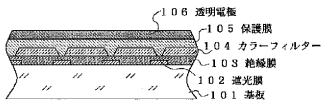
【0072】そのため透明電極106と遮光膜102との間隔を充分にとって、両者間の電気容量をできるだけ小さくする必要がある。そこで主に絶縁機能を重視する被膜を絶縁膜103とし、電気容量の低減化を図る被膜を保護膜105として、両者の材質あるいは膜厚を変えた場合においては、図6と図7は異なる構造となるのである。

### [0073]

【発明の効果】以上の説明で明かなように、本発明は導電性を有する遮光膜を有する液晶表示パネルにおいて、遮光膜と透明電極との間に新たに絶縁膜を設け、または隣合うカラーフィルターをオーバーラップることで、遮光膜と透明電極との間に、保護膜と絶縁膜、もしくはカラーフィルターと絶縁膜、またはカラーフィルター保護膜とからなる多層膜を形成する。これによりいずれかの層にピンホールがあっても、この多層膜構造で遮光膜と透明電極の電気的ショートの発生を確実に防止することができる。

【0074】このため遮光特性の不充分な絶縁体を用いた遮光膜を使用する必要がなく、遮光特性に優れ、しかも平坦性に優れた表示品質の高い液晶表示パネルを歩留まりを低下させること無く生産することができる。

【図1】



【 0 0 7 5 】しかも本発明の液晶表示パネルは、既存の 保護膜、あるいはカラーフィルターを利用して多層膜構 造を形成しているため、最小限の工程の追加で可能であ るから大幅な価格上昇もない。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図2】本発明の第2の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図3】本発明の第3の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図4】本発明の第4の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図5】本発明の第5の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図6】本発明の第6の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図7】本発明の第7の実施例における遮光膜を有する 基板を示す断面図である。

【図8】本発明の第8の実施例におけるの遮光膜を有する基板を示す断面図である。

【図9】従来の液晶表示パネルの構造を示す断面図である。

【図10】従来の液晶表示パネルの遮光膜を有する基板を示す断面図である。

【図11】従来の液晶表示パネルの遮光膜を有する基板を示す断面図である。

## 【符号の説明】

101 基板

102 遮光膜

103 絶縁膜

104 カラーフィルター

105 保護膜

106 透明電極

【図2】

